



RPS50EM

REMOTE PLASMA SOURCE

远程等离子体清洗源

The RPS50EM is a remote plasma cleaning source, which can be integrated into the SEM or FIB chambers. It efficiently cleans the chamber and sample hydrocarbons through the plasma generated by ionized gas, which can not only alleviate carbon contamination during the imaging process, but also improve the imaging resolution and contrast, and shorten chamber evacuation time. RF-ICP technology makes the plasma softer, which can greatly reduce the thermal damage and plasma bombardment damage during the cleaning process.

RPS50EM是一款远程等离子体清洗源，可集成于SEM或FIB腔体，通过电离气体产生的等离子体对腔室和样品碳氢化合物进行高效清洗，不仅可以解决成像过程中的积碳黑框现象，且可提高成像分辨率及衬度，缩短腔室抽真空时间。RF-ICP技术使得等离子体更温和，可大幅降低清洗过程中的热损伤和等离子体轰击损伤。

触摸屏控制，即插即用。



RF-ICP技术

等离子体更温和

低热损伤

低等离子体轰击损伤

电镜腔室大扫除

预抽室日常清洗

SuPro Instruments LTD

速普仪器

Nanshan,

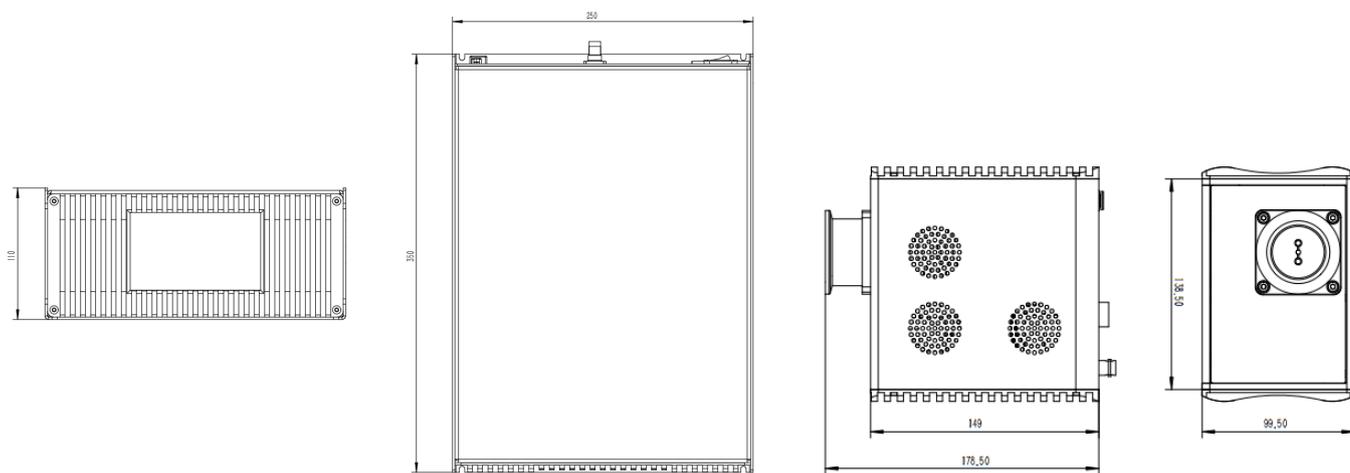
Shenzhen, China

www.suproinst.com

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

技术规格	参数
工作气压	0.5-40Pa
射频电源	13.56MHz射频电源，射频功率10-50W可调
气体模块	标配MFC 100sccm流量计 (N ₂) /1只
操作方式	触摸屏控制，控制系统提供互锁保护功能 提供串口控制指令，可供后续开发编程
尺寸	250mm长*350mm宽*110 mm高（控制器） 178.5mm长*138.5mm宽*99.5mm高（RF离子源）
重量	~9kg
连接方式	KF40法兰接口
进气系统	Ø6mm进气口
电源	100-220V AC，50/60Hz 接地三脚插头
功耗	< 200 W
质保	一年
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知，如有疑问请联系我们



控制器尺寸

离子源尺寸



深圳市速普仪器有限公司（总部）
地址：深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009
电话：0755-26642901 传真：0755-26419205
邮件：sales@suproinst.com
www.suproinst.com

深圳市速普仪器有限公司（北京办）
地址：北京市房山区怡和北路5号院熙悦汇4号楼307室
邮件：zkchang@suproinst.com
速普仪器（太仓）有限公司
地址：江苏省苏州市太仓市大学科技园11号楼1003室